

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011年8月4日(04.08.2011)



PCT



(10) 国際公開番号

WO 2011/093357 A1

- (51) 国際特許分類:
B29C 33/38 (2006.01) H01L 21/027 (2006.01)
B29C 59/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/051550
- (22) 国際出願日: 2011年1月27日(27.01.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-019664 2010年1月29日(29.01.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): H
O Y A 株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP];
〒1618525 東京都新宿区中落合二丁目7番5号
Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中塚 栄
(NAKATSUKA Sakae) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新
宿区中落合二丁目7番5号 H O Y A 株式会
社内 Tokyo (JP). 雨宮 勲 (AMEMIYA Isao)
[JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合二丁目7
番5号 H O Y A 株式会社内 Tokyo (JP). 木村
生 (KIMURA Ikuru) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿

区中落合二丁目7番5号 H O Y A 株式会
社内 Tokyo (JP).

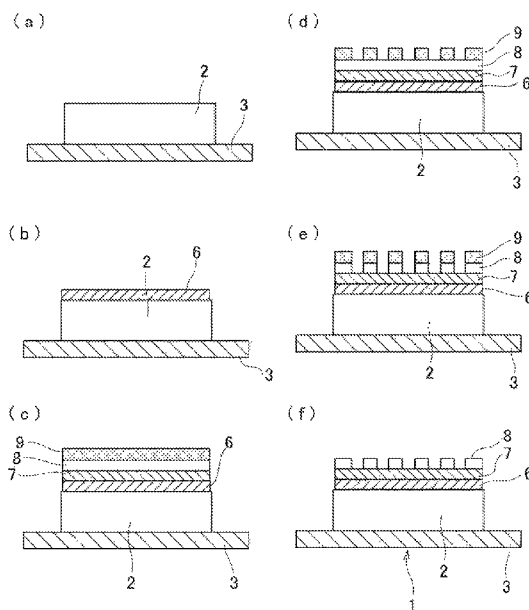
- (74) 代理人: 阿仁屋 節雄, 外 (ANIYA Setuo et al.); 〒
1020072 東京都千代田区飯田橋四丁目6番1号
2 1 東和ビル3 F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH,
PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: MOLD FOR IMPRINTING AND PRODUCTION METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: インプリント用モールド及びその製造方法

[図1]



(57) Abstract: Provided is a mold for imprinting which
comprises a substrate provided thereon a flattening layer
having a layer made of a flattening agent, wherein the
flattening layer is provided thereon a layer having a fine pat-
tern forming layer.

(57) 要約: 基材上に平坦化剤よりなる層を有
する平坦化層が設けられ、前記平坦化層上に
微細パターン形成用層を有する層が設けられ
たインプリント用モールドを提供する。

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))